

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005年8月4日 (04.08.2005)

PCT

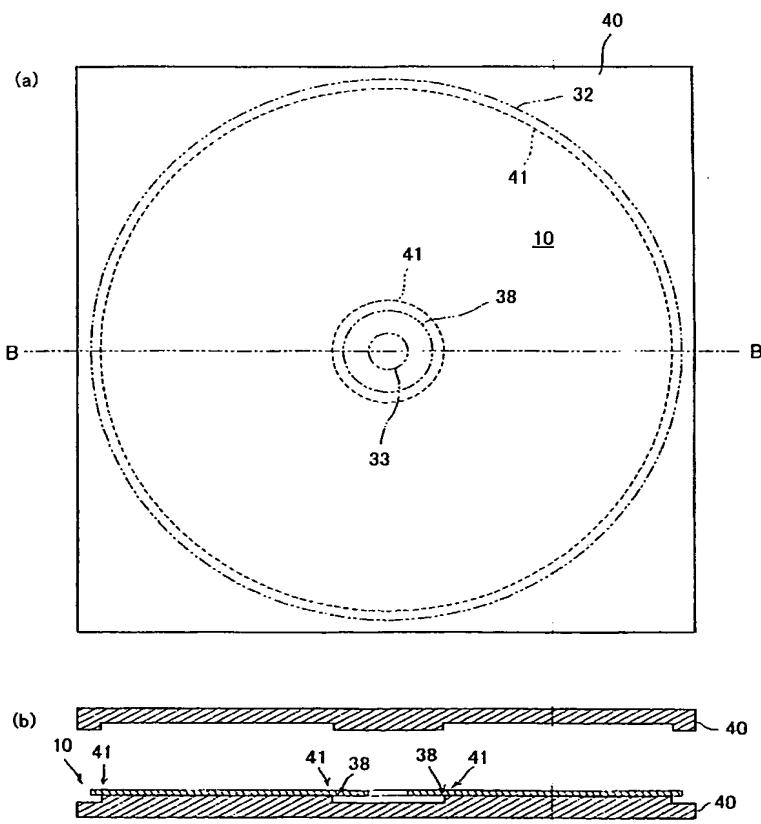
(10) 国際公開番号
WO 2005/070640 A1

(51) 国際特許分類: B29B 17/02, G11B 7/26, 25/04
(72) 発明者; および
(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/000591
(75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 伊藤智章 (ITO, Tomoaki) [JP/JP]; 〒5360014 大阪府大阪市城東区鴫野西一丁目 17 番 19 号 オリエント測器コンピュータ株式会社内 Osaka (JP).
(22) 国際出願日: 2005年1月19日 (19.01.2005)
(25) 国際出願の言語: 日本語
(74) 代理人: 藤田 隆 (FUJITA, Takashi); 〒5300044 大阪府大阪市北区東天満2丁目 10 番 17 号 マツイビル 5 階 Osaka (JP).
(26) 国際公開の言語: 日本語
(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
(30) 優先権データ:
特願2004-013601 2004年1月21日 (21.01.2004) JP
(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): オリエント測器コンピュータ株式会社 (ORIENT INSTRUMENT COMPUTER CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5360014 大阪府大阪市城東区鴫野西一丁目 17 番 19 号 Osaka (JP).

[続葉有]

(54) Title: METHOD FOR RECYCLING OPTICAL DISC, RESIN MOLDED ARTICLE, AND RECYCLED OPTICAL DISC

(54) 発明の名称: 光ディスクのリサイクル方法、樹脂成形物、再生光ディスク



(57) Abstract: A method for recycling an optical disc in which the resin used in an optical disc (10) can be recovered easily with high purity. The method for recycling an optical disc comprises a polishing step and a circumferential surface removing step. In the polishing step, a recording surface (31) of the optical disc (10) on the side opposite to the reading surface (30) where the substrate part (11) is exposed is polished until the substrate part (11) is exposed. In the circumferential surface removing step, portions in the vicinity of the outer circumferential surface (32) and the inner circumferential surface (33) is removed from the optical disc.

(57) 要約: 光ディスクのリサイクルにおいて、光ディスク (10) に使用されている樹脂をリサイクルを容易に純度よく回収することができるようになる。本発明の光ディスクのリサイクル方法では、研磨工程と周面除去工程とを有するものである。そして、研磨工程では、光ディスク (10) の基板部 (11) が露出した面である読み取り面 (31) とは反対の面である記録面 (31) を、基板部 (11) が露出するまで研磨する。また、周面除去工程では、外周面 (32) 及び内周面 (33) 付近を取り除く。



(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:
— 國際調査報告書